



高潔度部材の溶出・評価試験

半導体製造機器部品など高い清浄性が要求される材料、部品の各種評価試験を承ります。

電子材料部品、クリーンルーム内使用部材の清浄度評価

半導体製造装置などに使用する部品やクリーンルーム内で使用する容器、部材等には高い清浄度が要求され、金属粒子の発塵や金属などの溶出量を極微量まで厳密に制御、管理する必要があります。

当社は次のような対応によって、これらの部材の発塵量、溶出量などに関する精度の高い分析値をご提供いたします。

- 1) 清浄な環境下での処理 : **クリーンルーム**内で分析作業を行うことにより、環境からの試料汚染を防止します。
- 2) 汚染の少ない前処理 : **清浄な器具と高純度試薬**を使用することにより、試料の汚染を極力防止します。
- 3) 高精度の極微量分析技術 : **高感度分析装置**により、高精度の分析結果が得られます。

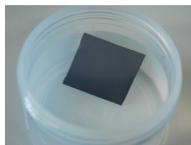
分析・評価例のご紹介

● 半導体製造装置構成部材の溶出成分評価

対象とする部材例: ネジ、配管部材、接着剤 など

部材を各種溶出液(酸、アルカリ、溶剤 等)に浸漬

金属パネル部材



接着テープ



樹脂ボード



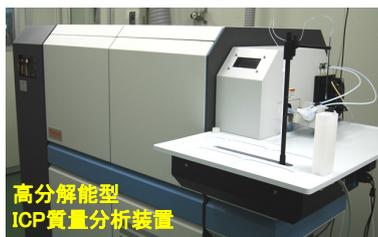
恒温槽で保持

オートクレーブ試験も承ります

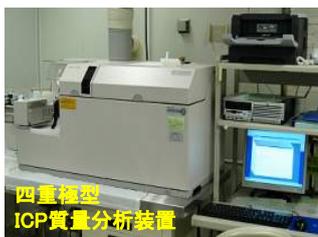


溶出液への溶出量を高感度分析

極微量金属成分分析



高分解能 ICP質量分析装置



四重極型 ICP質量分析装置

60数元素を対象とした定性分析も可能です。

● 各種部材の薬品(酸、アルカリ)透過性評価

対象とする部材例: 樹脂フィルム、チューブ、容器材料 など

部材を容器型にして
各種溶液(酸、アルカリ、溶剤 等)を充填

充填済みの容器を純水中に浸漬

純水への透過量を高感度分析

溶存イオン分析



イオンクロマトグラフィー

LC-MS/MS(液体クロマトグラフィー質量分析法)や、GC-MS(ガスクロマトグラフィー質量分析法)による有機成分分析にも対応いたします。



JFE テクノリサーチ 株式会社

<http://www.jfe-tec.co.jp>

0120-643-777

Copyright ©2014 JFE Techno-Research Corporation. All Rights Reserved.
本資料の無断複製・転載・webサイトへのアップロード等はおやめ下さい。